

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年1月6日 (06.01.2005)

PCT

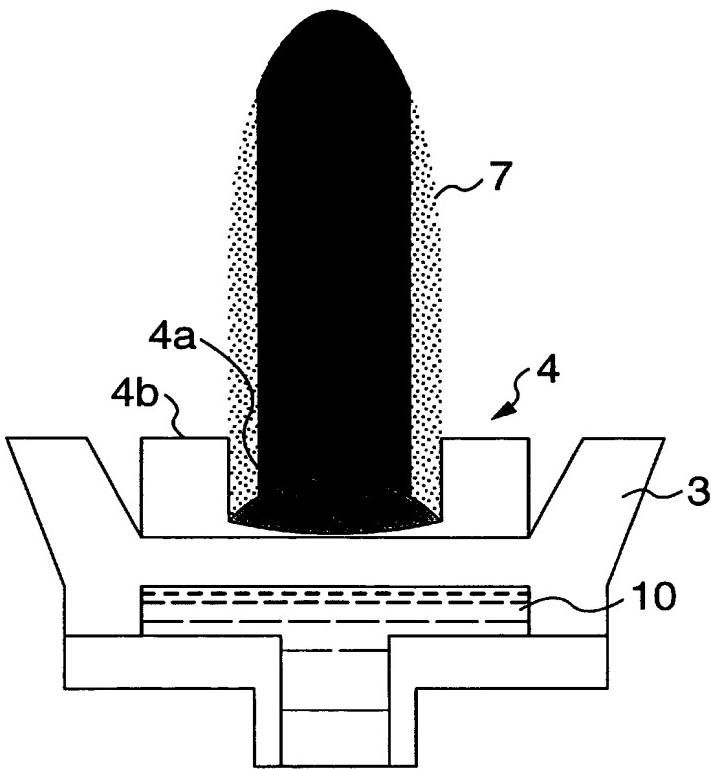
(10)国際公開番号  
WO 2005/001154 A1

- (51)国際特許分類<sup>7</sup>: C23C 14/32, B23B 27/14, 51/00, B23P 15/28
- (21)国際出願番号: PCT/JP2004/009158
- (22)国際出願日: 2004年6月29日 (29.06.2004)
- (25)国際出願の言語: 日本語
- (26)国際公開の言語: 日本語
- (30)優先権データ:  
特願2003-187564 2003年6月30日 (30.06.2003) JP  
特願2003-325405 2003年9月18日 (18.09.2003) JP
- (71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社不二越 (NACHI-FUJIKOSHI CORP.) [JP/JP]; 〒9308511 富山県富山市不二越本町一丁目1番1号 Toyama (JP).
- (72)発明者; および  
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 佐藤嗣紀 (SATO, Hideki) [JP/JP]; 〒9300964 富山県富山市東石金町11-17 Toyama (JP). 國部勝 (SONOBE, Masaru) [JP/JP]; 〒9300284 富山県中新川郡舟橋村竹鼻283-5 Toyama (JP). 加藤範博 (KATO, Norihiro) [JP/JP]; 〒9318328 富山県富山市犬島新町2-9-12 Toyama (JP). 安岡学 (YASUOKA, Manabu) [JP/JP]; 〒9398192 富山県富山市布市新町146 Toyama (JP).
- (74)代理人: 浅村皓, 外 (ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル331 Tokyo (JP).
- (81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

(統葉有)

(54)Title: MULTINARY DEPOSITION FILM PRODUCTION STABILIZING DEVICE AND METHOD, AND TOOL WITH MULTINARY DEPOSITION FILM

(54)発明の名称: 多元系被膜の製造安定化装置と方法および多元系膜被覆工具



蒸発させるに必要な電力を最初に供給し、その後、最初の電力より順次増大した電力を必要とするまで繰り返して供給する。或いは、原料を蒸発させるに必要な最初の領域にプラズマ(7)を收

(57)Abstract: A production stabilizing device and method for forming a multinary deposition film having a good quality and containing metal components such as TiAlN having greatly different melting points with a high material use efficiency by means of a single crucible (3) and a converged plasma (7). Electric power necessary to evaporate a material (4) is first supplied, and then the supplied electric power is increased in steps up to the necessary maximum electric power repeatedly. Alternatively, plasma control is conducted to converge a plasma (7) in a first region necessary to evaporate the material and plasma control is conducted to continuously and sequentially move and expand the plasma from the first plasma region to the maximum plasma region so as to sequentially melt the unmelted portion (4b) of the material. The material is a sintered body or a green compact formed body (4).

(57)要約: 製造安定化装置および方法は、TiAlN等の融点の大きく異なる金属成分を持つ多元系被膜を、単一のルツボ(3)と収束プラズマ(7)とを用いて、高原料利用効率で、膜質良く作製する。この時、原料(4)を

(統葉有)

WO 2005/001154 A1



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。